

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일
2020년 11월 26일 (26.11.2020) WIPO | PCT



(10) 국제공개번호
WO 2020/235812 A1

- (51) 국제특허분류:
B03C 3/16 (2006.01) *B03C 3/68* (2006.01)
- (21) 국제출원번호: PCT/KR2020/005123
- (22) 국제출원일: 2020년 4월 16일 (16.04.2020)
- (25) 출원언어: 한국어
- (26) 공개언어: 한국어
- (30) 우선권정보:
10-2019-0058287 2019년 5월 17일 (17.05.2019) KR
- (71) 출원인: 주식회사 이서 (AETHER, INC.) [KR/KR];
34051 대전시 유성구 문지로 193, T213, Daejeon (KR).
- (72) 발명자: 김재현 (KIM, Jaehyun); 34140 대전시 유성구
어은로 57, 132동 602호, Daejeon (KR). 이상원 (LEE,
Sang Won); 34094 대전시 유성구 노은로 426번길 97,
Daejeon (KR). 배인식 (BAE, Inshik); 35221 대전시 서구
월평로 27번길 16, 203호, Daejeon (KR).
- (74) 대리인: 특허법인 아이피에스 (IPS PATENT FIRM);
06656 서울시 서초구 반포대로23길 14, 5층, Seoul (KR).
- (81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국
내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC,

EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU,
ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW,
KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK,
MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA,
PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD,
SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ,
UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

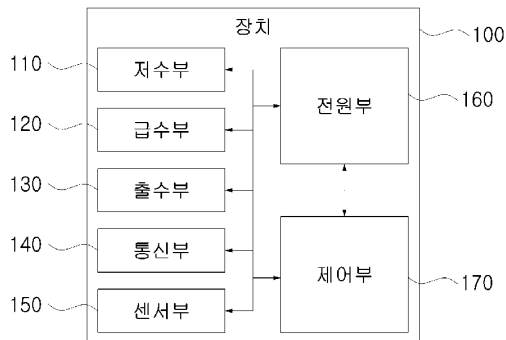
- (84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역
내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM, KE,
LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM,
ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유
럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK,
MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

공개:

— 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))

(54) Title: DEVICE AND METHOD FOR MANAGING FINE PARTICLE CONCENTRATION

(54) 발명의 명칭: 미세 입자 농도를 관리하기 위한 장치 및 방법



100 ... Device
110 ... Water storage unit
120 ... Water supply unit
130 ... Water discharge unit
140 ... Communication unit
150 ... Sensor unit
160 ... Power supply unit
170 ... Control unit

(57) Abstract: An aspect of the present invention relates to a device for supplying a charge to a target area and managing a fine particle concentration of the target area, the device comprising: a container for storing a liquid; at least one nozzle for outputting the liquid; a pump for supplying the liquid from the container to the at least one nozzle; a power source for supplying electric power to the device; and a controller for supplying a charge to the target area through the at least one nozzle by using the power source, wherein the controller applies a voltage having a value equal to or greater than a reference value to the at least one nozzle by using the power source, and an electric force in a direction away from the device is provided to a fine particle in the target area charged by the supplied charge.

(57) 요약서: 본 발명의 일 양태는, 대상 영역에 전하를 공급하여 대상 영역의 미세 입자 농도를 관리하는 장치에 있어서, 액체를 저장하는 용기, 상기 액체를 출력하는 적어도 하나의 노즐, 상기 용기로부터 상기 적어도 하나의 노즐로 상기 액체를 공급하는 펌프, 상기 장치에 전력을 공급하는 전원 및 상기 전원을 이용하여 상기 적어도 하나의 노즐을 통하여 상기 대상 영역에 전하를 공급하는 컨트롤러를 포함하고, 상기 컨트롤러는 상기 전원을 이용하여, 적어도 하나의 노즐에 기준 값 이상의 전압을 인가하고, 상기 공급된 전하에 의해 대전된 상기 대상 영역의 미세 입자에 상기 장치로부터 멀어지는 방향의 전기력을 제공하는 장치에 관한 것이다.



WO 2020/235812 A1